

## عنوان مقاله:

بررسی ویژگی های اپتیکی و الکتریکی لایه های نازک اکسید روی لایه نشانی شده بر روی لایه های نازک الومینا به شیوه کندو پاش RF

## محل انتشار:

پانزدهمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران (سال: 1387)

تعداد صفحات اصل مقاله: 5

## نویسندگان:

شیده کبیری عامری ابو ترابی - آزمایشگ

نسرین خزامی پور - آزمایش

ابراهیم اصل سلیمانی - آزمایشگاه تحقیقاتی لایه های نازک ، گروه مهندسی برق و کامپیوتر ، دانشک

شمس الدین مهاجر زاده - آزمایشگاه تحقیقاتی لایه های نازک ، گروه مهندسی برق و کامپیوتر ، دانشک

## خلاصه مقاله:

در این تحقیق لایه های نازک اکسید روی (ZNO) با توانهای مختلف بر روی لایه هایی از آلومینا ( $Al_2O_3$ ) به شیوه کندو پاش RF لایه نشانی شده و ساختار کریستالی مورفولوژی سطح مقاومت ویژه عبور نوری لایه ها در ناحیه مرئی به ترتیب توسط آنالیزهای XRD ، SEM اندازه گیری مقاومت و طیف سنجی UV/VIS/IR بررسی شده است . نتایج نشان می دهد که با افزایش توان عبور نوری لایه های اکسید روی در ناحیه مرئی افزایش و شدت کریستالی لایه ها کاهش می یابد . رشد لایه ها در جهت کریستالی (002) بوده و کمترین مقاومت ویژه مربوط به لایه های اکسید روی لایه نشانی شده با توان 150 وات می باشد

## کلمات کلیدی:

آلومینا ، اکسید روی ، کند و پاش ، لایه های نازک

## لینک ثابت مقاله در پایگاه سیویلیکا:

<https://civilica.com/doc/65011>

